

マスクレス リソグラフィー Workshop

～ 技術セミナーと体験実習 ～

2024年6月11日(火)

参加費無料

9:30～13:00 技術セミナー(ハイブリッド開催)

(13:00～14:00 ランチミーティング 無料)

14:00～17:00 体験実習(定員有/先着順)

京都大学 吉田キャンパス 百周年時計台記念館 国際交流ホール I

<https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/yoshida/map6r-y> (構内マップ3番)

参加登録フォーム (体験実習の定員は延べ15名 先着順)

<https://forms.gle/BBtguXTBBDyFMNbQ8> 6/6(木)まで



Heidelberg Instruments社製 2光子重合式3Dプリンター MPO 100の国内初導入にあたり、『マスクレス リソグラフィー Workshop』を開催致します。午前: 技術セミナー (ハイブリッド開催), 午後: 体験実習 (定員有/先着順)

産官学いずれのご所属の方も奮ってのご参加をお待ちしております。

参加申込リストは京大ナノハブ拠点とハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社から、ご案内に利用させていただく場合がありますので予めご了解下さい。

9:30～13:00 技術セミナー (オンサイト+Zoom:ハイブリッド開催)

技術紹介

- ・マスクレス露光装置 : MLA 150
- ・レーザー直描装置 : DWL シリーズ
- ・2光子重合式 3Dプリンター : MPO 100
- ・Nano Frazer system and thermal-probe technology
- ・近接効果補正システム : BEAMER

Heidelberg Instruments Mikrotechnik

GenlSys K.K.

事例紹介

- ・DWL 2000を用いたグレイスケール露光技術

京大ナノハブ拠点

拠点紹介

- ・京都大学ナノテクノロジーハブ拠点

13:00～14:00 ランチミーティング (軽食有り: 無料)

14:00～17:00 Hands-on (体験実習)

コース

時間

・定員 : 各コース3名 (延べ15名) 先着順

・MPO100[1又は2]とMLA150[2又は1]の連続受講可能



MPO 100 [1]

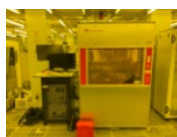
14:00～16:00

MPO 100 [2]

15:00～17:00

内容: 2光子重合3D描画

講師: Heidelberg Instruments



MLA 150 [1]

14:00～16:00

MLA 150 [2]

15:00～17:00

内容: 6インチ高速全面描画

講師: 京大ナノハブ



DWL 2000

14:00～17:00

内容: グレイスケール描画

講師: GenlSys K.K./京大ナノハブ

プログラム

9:30~13:00 技術セミナー

会場 百周年時計台記念館 国際交流ホール I

9:15 ~	来場登録
9:30 ~	Welcome, Nanotechnology Hub, Kyoto University / 京都大学 教授 土屋 智由
9:40 ~	Company introduction, technical talk focus on Maskless Aligner MLA 150 and Grayscale/DWL / Heidelberg Instruments Mikrotechnik Technical Application Manager Dominique Collé
10:20 ~	Fabrication of inclined helical channels using grayscale lithography with DWL2000 / 京都大学 ナノテクノロジーハブ拠点 技術職員 高橋 英樹
10:40 ~	GenISys BEAMER application for laser direct writing / GenISys株式会社 アプリケーションエンジニア 清水 諭
11:10 ~	休憩
11:30 ~	Technical talk TPP technology, MPO 100 system, applications / Heidelberg Instruments Mikrotechnik Head of TPP Process and Application Lab Willi Mantei
12:10 ~	Nano Frazer system and thermal-probe technology / Heidelberg Instruments Nano Business Development Engineer Fei Yang
12:40 ~	Introduction of Nanotechnology Hub Kyoto University / 京都大学 ナノテクノロジーハブ拠点 研究員 鈴木 正彦
12:55 ~	総括
13:00 ~ 14:00	ランチミーティング (国際交流ホール II)

14:00~17:00 Hands-on (体験実習) ※各コース定員3名

会場 総合研究6号館 ナノテクノロジーハブ拠点 クリーンルーム
(集合場所 百周年時計台記念館 国際交流ホール I 前廊下)

2光子重合式3Dプリンター MPO 100 ・内容：2光子重合3D描画 ・講師：Heidelberg Instruments Mikrotechnik Head of TPP Process and Application Lab Willi Mantei	第1回 14:00 ~ 16:00
	第2回: 15:00 ~ 17:00
マスクレス露光装置 MLA 150 ・内容：6インチ高速全面描画 ・講師：京都大学 ナノテクノロジーハブ拠点 技術職員 江崎 裕子	第1回: 14:00 ~ 16:00
	第2回: 15:00 ~ 17:00
レーザー直描装置 DWL 2000 ・内容：グレイスケール ・講師：京都大学 ナノテクノロジーハブ拠点 技術職員 高橋 英樹 GenISys株式会社 アプリケーションエンジニア 清水 諭	14:00 ~ 17:00